นายทนงศักดิ์ สุขเกษม: การผลิตก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากกระบวนการโฟโตคะตะ ไลซิสเพื่อการฆ่าเชื้อบนพื้นผิว (PRODUCTION OF HYDROGEN PEROXIDE GAS FROM PHOTOCATALYSIS FOR SURFACE DISINFECTION) อาจารย์ที่ปรึกษา: อ. ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์, 135 หน้า.

คำสำคัญ : โฟโตคะตะไลซิส; ก๊าซไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์; TiO₂/SiO₂; ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง; การฆ่าเชื้อบนพื้นผิว; ความชื้นสัมพัทธ์

งานวิจัยนี้ศึกษาการผลิตก๊าซ H₂O₂ จากกระบวนการโฟโตคะตะไลซิสเพื่อการฆ่าเชื้อบน พื้นผิว แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกค<mark>ือส</mark>ร้างเครื่องปฏิกรณ์โฟโตคะตะไลซิสสำหรับระบบก๊าซ และทดสอบความเป็นไปได้ของงานวิจัย ส่วนที่สองคือหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับสังเคราะห์ก๊าซ H_2O_2 จากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ส่วน<mark>ที่</mark>สามคื<mark>อ</mark>ศึกษาบทบาทของ SiO_2 ในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ${\sf TiO_2/SiO_2}$ ส่วนที่สี่คือทดสอบการกระจายตัวของก๊าซ ${\sf H_2O_2}$ ที่สังเคราะห์ได้ในห้องจำลองปริมาตร 0.027 m³ ร่วมกับการทดสอบฆ่าเชื้อ E. coli แ<mark>ละก</mark>ารฆ่าเชื้อบนพื้นผิวอาหาร ส่วนสุดท้ายคือ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก**้**าซ H_2O_2 การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์สำหรับ กระบวนการโฟโตคะตะไลซิสข<mark>องร</mark>ะบบก๊าซมีส่วนประก<mark>อบ</mark>สำคัญ ได้แก่ วัสดุรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยแสง แหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลต พัดลมระบายอาก<mark>า</mark>ศ และแผ่นกรองอากาศ จากการศึกษา พบว่ากระบวนการโฟโตค**ะต**ะไล<mark>ซิสสามารถสังเคราะห์ก๊า</mark>ซ H_2O_2 ได้สูงสุดที่ค่า 3 ppmv โดยเครื่อง ปฏิกรณ์อนุกรม 3 หน่ว<mark>ย สภาวะที่เหมาะสม ได้แก่ ความ</mark>ชื้นสั<mark>มพัท</mark>ธ์ในอากาศเท่ากับ 60-65% RH อัตราการไหลของอาก<mark>าศเท่า</mark>กับ 12.0 เมตรต่อวินาที ตัวเร่<mark>งปฏิก</mark>ิริยาด้วยแสงชนิด $TiO_2/1\%SiO_2$ อนุภาค SiO_2 ต่ำกว่า 63 <mark>ไมโครเมตร การปรับปรุงทางสัณฐานวิ</mark>ทยาตัวเร่งปฏิกิริยา TiO_2 ด้วย SiO_2 ก่อให้เกิดโครงสร้างรูพรุนบนพื้<mark>นผิวและมีการเกิดโครงสร้างแล</mark>ะหมู่พันธะ Ti-O-Si ซึ่งมีบทบาทในการ ้ดักจับอิเล็กตรอนและโฮลบนพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาและเพิ่มหมู่ไฮดรอกซิลบนพื้น ซึ่งมีผลในการดึงดูด โมเลกุลสารตั้งต้น จากผลการทดสอบด้วย XRD พบว่ามีการเกิดโครงสร้างเฟสผสมระหว่าง อนาเทส/ รูไทล์/อสัณฐาน ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงวิถีทางของอิเล็กตรอนและโฮลในตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง จากการทดสอบในห้องจำลองพบว่าก๊าซ H_2O_2 ที่กระจายตัวในห้องจำลองมีประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ บนพื้นผิวแห้งเป็นหลัก การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของเทคโนโลยีก๊าซ H_2O_2 เหมาะสำหรับ การใช้งานด้านการฆ่าเชื้อบนพื้นผิวแห้ง กลุ่มลูกค้ามีความสนใจผลิตภัณฑ์ในประเด็นการใช้งานไม่ จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจหลักในการเปลี่ยนการใช้งานผลิตภัณฑ์เดิมมาใช้เทคโนโลยีก๊าซ H_2O_2

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมเคมี</u> ปีการศึกษา <u>2565</u> ลายมือชื่อนักศึกษา **พนงศักดิ์ สุงเกษม** ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา **ธุพระพิ จับก**นักระบุ สายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม *M. Oncomi*

TANONGSAK SUKKASEM: PRODUCTION OF HYDROGEN PEROXIDE GAS FROM PHOTOCATALYSIS FOR SURFACE DISINFECTION. THESIS ADVISOR: SUPUNNEE JUNPIROM, Ph.D. 135 PP.

Keywords: photocatalysis; hydrogen peroxide gas; TiO₂/SiO₂; photocatalyst; surface disinfections; relative humidity

This work aimed to study the production of hydrogen peroxide gas (H₂O₂) from photocatalysis for surface disinfection. There are five main parts. The first part is to fabricate the photocatalytic reactor for gas systems and test the feasibility of research. The second part involves the investigation of the optimal conditions for synthesis of H_2O_2 gas from humidity in the air. The third part is to study the role of SiO_2 in TiO_2/SiO_2 . The fourth part is the investigation of the distribution of synthesized H₂O₂ in the chamber of 0.027 m³ with the *E. coli* disinfection and food surface disinfection. The last part provides a business plan to assess the feasibility of H₂O₂ gas technology. The reactor for the gas system was fabricated including the main components; photocatalyst material, UV light source, ventilation fan and air filter. From the results showned that the fabricated reactor with 3 series of coated photocatalyst supporting plates can synthesize the H₂O₂ gas up to 3 ppmv with optimal conditions of relative humidity at 60-65% RH, an air flow rate of 12.0 m/s with the TiO₂/1%SiO₂ consisting of the SiO₂ particle is less than 63 µm. Modification of TiO₂ morphology with SiO₂ created the pore structure on the surface. There is the formation of Ti-O-Si structures which plays a role in electron and hole trapping on the photocatalyst surface and adding the hydroxyl groups on the surface to attract the reactant molecules. The XRD results showed that there is the appearance of the mixed phase structure between anatase/ rutile/amorphous, this resulting structure improves the electron and hole pathways in the photocatalyst. The dispersed H₂O₂ gas in the simulation chamber showed that it did work well for dry surfaces. The feasibility was studied for business assessment of H_2O_2 gas technology to be suitable for the application of dry surface disinfection. The target group of the customer is interested in this product due to its advantage of unlimited usage. It is the main motivation to switch traditional products to be the H₂O₂ gas technology.

School of <u>Chemical Engineering</u> Academic Year <u>2022</u> Student's Signature Tanongsak Sukkasem

Advisor's Signature Supunne J.

Co-Advisor's Signature Maconai